

OIM-DC/TEAM/APEX (実習ではOIM-DCを使用)

		Entry	Basic	Advance	
OIM-DC全般	OIM-DCの概説/構成	○	○		
	EBSDFパターンの指数付について		○	△	
	結晶方位の算出に関する計算法について		△	○	
	結晶方位の算出について(3バンド法について)	○	○	△	
	CI値の意味について	○	○		
	Fit値の意味について		○		
	Phase Page について	Phase データのLoad について	○	○	
		Phase Parameters の見方	○	△	○
	Hough Page について	Hough 変換の原理について	○	○	△
		Hough 変換のパラメーターについて	○	○	△
Index Page について	Solutions の見方	○	○	△	
	HKLs の見方		△	○	
	Ranking Factor について			○	
	Pseudosymmetry について			○	
	バンドの追加/削除について		△	○	
Interactive Page について	SEM像の取込/保存について	○	○		
	パターンの指数付け/保存(Record)について	○	○		
	Analysis 部分の見方について		△	○	
Scan Page について	測定領域の設定について	○	○		
	Combo Scan について			○	
	パターンの記録につて	○		○	
	ChiScan について			○	
Simulation Page について	Unit Cell/PF/IPF の表示について	○	○	○	
キャリブレーションについて	キャリブレーションの考え方について	○	○		
	SEMのWDにキャリブレーション値を合わせる	○	○		
	Si 単結晶でキャリブレーションを行う			○	
	一時的なキャリブレーションを行う		○	○	
Setting Menu について	Preference の設定		○	○	
	Superuser の設定			○	
その他の機能	SEM 像の Brightness/Contrast の調整			○	
	取込むSEMの解像度の設定について			○	
	SEM像の傾斜補正について		○	○	
検出器の調整	Gain, Black, Exposure と照射電流の関係	○	○		
	Binning パラメータとConvolution Mask の関係			○	
Background 処理について	Background処理の考え方	○	○		
	Standard モードによるBackground 処理		○		
	Enhanced モードによるBackground処理(1)	○	○	○	
	Enhanced モードによるBackground処理(2)			○	
SEM の条件設定	加速電圧の効果	○	○	△	
	倍率と分解能の関係		○	△	
	統計的データの意味			○	
透過EBSDF法に関して	透過EBSDF法とは		○	○	
	透過EBSDF法における試料のセットについて		○	○	
	試料厚さの効果について			○	
	透過電子線の処理について			○	
	Hough変換パラメーターのチューニング			○	
マテリアルデータの作成に関	同一結晶系/類似データの編集による作成			△	
	ICDD等データベースを利用したデータの作成			△	
	実際のパターンから結晶の対称性を推測			△	
	実際のパターンでのマッチングによる確認			△	

TEAM/APEX については、操作画面の紹介でHough変換等の実習は ライセンスの関係でOIM-DCを使用して行います。